

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 6 部門第 2 区分

【発行日】平成30年2月1日 (2018.2.1)

【公開番号】特開2015-143836(P2015-143836A)

【公開日】平成27年8月6日 (2015.8.6)

【年通号数】公開・登録公報2015-050

【出願番号】特願2014-255021(P2014-255021)

【国際特許分類】

G 0 3 G 15/08 (2006.01)

G 0 3 G 9/08 (2006.01)

【 F I 】

G 0 3 G 15/08 2 3 5

G 0 3 G 9/08 3 7 5

【手続補正書】

【提出日】平成29年12月12日 (2017.12.12)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 8 6

【補正方法】変更

【補正の内容】

【 0 0 8 6 】

(式 4) 理論被覆率 $\times 2$ (面積 %) = $3^{1/2} / (2) \times (d t / d a) \times (t / a) \times C \times 100$

(式 4) において、

d a : シリカ微粒子の一次粒子の個数平均粒径 (D 1) 、

d t : トナーの質量平均粒径 (D 4) 、

a : シリカ微粒子の真比重、

t : トナーの真比重、

C : シリカ微粒子の質量 / トナーの質量

(C は後述するトナー中のシリカ微粒子の含有量を用いる。) 、である。